

平成 21 年度検索エキスパート研修 [中級 (IPDL 編)] 実施結果について (お知らせ)

平成 22 年 4 月 9 日
(独)工業所有権情報・研修館

平成 21 年度当館では検索エキスパート研修 [中級 (IPDL 編)] を 2 回実施いたしました。以下にその実施結果をお知らせ致します。

本研修は、研究者や大学等の知的財産本部、技術移転機関の関係者を主な対象とし、特許情報を活用して、研究のテーマ・方向性を決定するための検索や、特許出願・審査請求の要否の判断をするための検索を的確に行うことができる人材の育成を目的に実施しております。

1. 研修概要

	第1回	第2回
開催日時	12月8日～10日 (3日間)	1月15日～17日 (3日間)
開催場所	工業所有権情報・研修館 (東京都)	富士通オープンカレッジ 名古屋駅前校(愛知県)
受講者人数	32名	14名
受講証書 交付人数	32名	14名

2. アンケート結果

(1) 本研修についての総合評価

	第1回		第2回	
非常に有意義であった	13名	44.8%	11名	78.6%
有意義であった	16名	55.2%	3名	21.4%
あまり有意義でなかった	0名	0.0%	0名	0.0%
有意義でなかった	0名	0.0%	0名	0.0%

(2) 研修生からのコメント

- ・ F タームの使い方を一応、理解することができた。
- ・ 基礎から実践まで丁寧に指導頂き、今後の実務に活かせそうで、大変感謝しています。
- ・ 分類・検索説明がもう少しゆっくりだったら良かったと思いました。
- ・ 非常に有用でしたが、消耗しました。もう少し時間的余裕があればと思います。
- ・ 検索演習だけの研修もやって欲しい。



< 第 2 回の研修風景 >